This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 (11) 国際公開番号 C03C 3/091, 3/093. WO97/11920 A1 (43) 国際公開日 1997年4月3日(03.04.97) (21) 国際出願番号 PCT/JP96/02751 (81) 指定国 DE, JP, KR, US. (22) 国際出願日 1996年9月25日(25.09.96) 添付公開書類 国際調査報告書 (30) 優先権データ

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本電気硝子株式会社

1995年9月28日(28.09.95)

(NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.)[JP/JP] 〒520 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 Shiga, (JP)

(72) 発明者:および

特願平7/276760

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

三和晉吉(MIWA, Shinkichi)[JP/JP] 〒520 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号

日本電気硝子株式会社内 Shiga, (JP)

(74) 代理人

弁理士 後藤洋介, 外(GOTO, Yosuke et al.) 〒105 東京都港区西新橋1丁目4番10号 第三森ビル Tokyo, (JP)

(54)Title: ALKALI-FREE GLASS SUBSTRATE

(54)発明の名称 無アルカリガラス基板

(57) Abstract

An alkali-free glass substrate that is substantially free from any alkali metal oxide, has a chemical resistance and a high strain point, is excellent in meltability and devitrification resistance, and comprises on the weight basis 58.0 to 68.0 % SiO₂, 10.0 to 25.0 % Al₂O₃, 3.0 to 15.0 % B₂O₃, 0 TO 2.9 % MgO, 0 to 8.0 % CaO, 0.1 to 5.0 % BaO, 0.1 to 10.0 % SrO, 0 to 5.0 % ZnO, 0 to 5.0 % ZrO₂, and 0 to 5.0 %

実質的にアハカリ金属酸化物を含有せず、耐薬品性を有し、高い歪点を有する とともに、優れた溶融性及び耐失透性に優れた無アルカリがラス基極を提供する ために、優れた溶散性及び耐失透性に優れた無アルカリ金属酸化物を含有せず、重 ために、無アルカリガラス基板は、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、重 電百分率で、SiO。 58.0~68.0%、A¹2 O3 10.0~25.0%、B重 0%、B2 O3 3.0~15.0%、M2O0~2.9%; CaO0~8.0%,B2 O3 3.0~15.0% M2O0~2.9%; CaO0~8.0%,B2 O3 0.1~5.0%; M2O001~1~1·0.0~3.0%; B2O001~200~3.0%; B2O001~3.0%; B2O001

明 細 書

無アルカリガラス基板

技術分野

本発明は、液晶ディスプレイ、ELディスプレイ等のディスプレイ、フィルター、センサー等の基板として用いられる無アルカリガラス基板に関するものである。

背景技術

従来より、液晶ディスプレイ等のフラットパネルディスプレイ、フィルター、 センサー等の基板として、ガラス基板が広く使用されている。

この種のガラス基板の表面には、透明導電膜、絶縁膜、半導体膜、金属膜等が 成膜され、しかもフォトリソグラフィーエッチング(フォトエッチング)によっ て種々の回路やパターンが形成される。これらの成膜、フォトエッチング工程に おいて、ガラス基板には、種々の熱処理や薬品処理が施される。

例えば、薄膜トランジスタ(TFT)型アクティブマトリックス液晶ディスプレイの場合、ガラス基板上に絶縁膜や透明導電膜が成膜され、さらにアモルファスシリコンや多結晶シリコンのTFTが、フォトエッチングによって多数形成される。このような工程において、ガラス基板は、数百度の熱処理を受けると共に、硫酸、塩酸、アルカリ溶液、フッ酸、バッファードフッ酸等の種々の薬品による処理を受ける。

特にバッファードフッ酸は、絶縁膜のエッチングに広く用いられるが、ガラス を侵食してその表面を白濁させやすく、またガラス成分と反応して反応生成物が でき、これが工程中のフィルターをつまらせたり、基板上に付着することがある。

また塩酸は、ITO膜やクロム膜のエッチングに用いられるが、これもガラスを侵食してその表面を変色させたり、白濁やクラックを生じさせ易い。よって、この種のガラス基板には、耐バッファードフッ酸性と耐塩酸性を付与することが大変重要となる。

WO 97/11920 PCT/JP96/02751

スではるれる用動コトンでストデ晶強ス々でリイケントテクで墜工す工プで鋭

- イオンが成膜された半導体物質中に拡散し、膜特性の劣化を招くため、実質的に アルカリ金属酸化物を含有しないこと。
- よって劣化しないような耐薬品性を有すること。 (3) 成膜, アニール等の工程における熱処理によって, 熱収縮しないこと。そのため高い歪点を有すること。例えば多結晶シリコンTFT-LCDの場合, そ
- る。 ・ 合品のしつユーエイエンとでくる語話をおかれるコンとくいっか。 ・ にのような用数をあるでいるのでのといった。 ・ はいがあるののでいるでは、このような用級のからはである。 ・ はいかがあるのでは、このようなは、このような用級のからは、 ・ はいかがある。
- 点が650℃以上であることが要求される。 また容融性,成形性を考慮して,この種のガラス基板には,以下のような特性
- も要求される。 も要求される。 も要求される。 ものは、またして好きしくない容融欠陥が、発生しないよう。 を発性に
- 展れていること。 また近年, TFT型アクティブマトリックス液晶ディスプレイ等の電子機器は,パーソナルな分野への利用が進められており,機器の軽量化が要求されている。 これに伴ってガラス基板にも軽量化が要求されており、 満本化が進みられている。
- るいフホま室なくこるもく母を恵密のスでは、う时目も図る フホらい用コ対基トリアストデ品郊ス々ゃじイマファマファで型TJTC1未来が ミルてひ及スでは競封豚Aウじい、スでは英子、おフリシスではじたいて無るい
- もが高いという難点がある。 またべりかム碉珪酸ガラスとしては、市販品としてコーニンが社製#7059

が存在するが、このガラスは耐酸性に劣るため、フォトエッチング工程においてガラス基板の表面に変質や白濁、荒れが生じやすく、しかも基板からの溶出成分によって薬液を汚染しやすい。さらにこのガラスは、歪点が低いため、熱収縮や熱変形を起こしやすく、耐熱性に劣っている。また、その密度も、 $2.76g/cm^3$ と高い。

また、アルミノ珪酸塩ガラスは、耐熱性に優れているが、現在市場にあるガラス基板の多くが、溶融性が悪く、大量生産に不向きである。また、これらのガラス基板は、密度が $2.7\,\mathrm{g/c\,m^3}$ 以上と高かったり、耐バッファードフッ酸性に劣るものが多く、全ての要求特性を満足するものは未だ存在しないというのが実情である。

そこで、本発明の目的は、上記した要求特性項目(1)~(5)の全てを満足し、しかも密度が 2. $55\,\mathrm{g/c\,m^3}$ 以下の無アルカリガラス基板を提供することである。

発明の開示

本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分率で、 SiO_2 58.0~68.0%、 Al_2O_3 10.0~25.0%、 B_2O_3 3.0~15.0%、MgO 0~2.9%、CaO 0~8.0%、BaO 0.1~5.0%、SrO 0.1~10.0%、ZnO 0~5.0%、 ZrO_2 0~5.0%、 TiO_2 0~5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする。

発明の実施するための最良の形態

本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分率で、 S_{-i} O_{2} 58.0~68.0%, A_{12} O_{3} 10.0~25.0%, B_{2} O_{3} 3.0~15.0%, M_{20} O_{20} 9%, C_{20} O_{20} 0%, O_{20} O_{20}

PCT/JP96/02751 07611/L6 OM

由野けし宝別コによの話土を代放放散の郊基スではじた小で無の服発本、でま

。るむ〉を今し出市は成異数夫のイトラバイスじて31中スラは、しか悪〉し書 冷曲表夫師、ゴ共らるも小悪冷却蝸沓、ひな〉き大冷鬼器監高、ちるな〉をひよ ※90、83、4量音音のう、らがないしない。よせち音舎上以※0、83 おで明発本 . ちちまか多いほど、密度が低くなり,2.55g/cm^が 以下にし易くなるため, の。012。るよう代類るならマーマーキワヤーワイッキのスでは、却。012 こういて、説明する。

SiO2 の好ましい含有量は、58.5~67.0%である。

,ひな〉高が恵浩監高のスミは、、31共らるな〉を今じ主が断白コ面表の改基スミは 点が低下する。また25.0%より多いと、耐バッファードフッ酸性が低下し、 単%向函数夫 、5いな心である。10.0%より少ないと、5~0.3 1 は1 5 J ま

5. B2 03 の含有量は, 3. 0~15. 0%, 好ましくは6. 5~15. 0%, 。るでか悪が思袖的

.3 I 六字。るも不出が出類でてドートてでい価、コ共らるなら代十不がき層の より好害しくは8.5~15.0%である。3.0%より少ないと、題前として

°921

そ透傾向が増大するため好ましくない。 従って, MgOの含有量は, 0~2. 9 、」るも斉舎コ量そ多0gM、J心し。るよう代数いき大心果校る刊不多関密な最 育している成分である。そして、MgOは、二価のアルカリ土類酸化物の中で、

は1.8~7.5%, さらに好ましくは2.1~7.5%である。8.0%より >しませ、%0、8~0、は量音合のOsO。るるつ代気をすぎ用引るも善改 SaOも, MgOと同様に歪点を下げずに高温粘性を下げ, ガラスの容融性を % 好ましくは0~1%である。

WO 97/11920 PCT/JP96/02751

多いと、ガラスの耐バッファードフッ酸性が著しく悪化するため好ましくない。 すなわちガラスをバッファードフッ酸で処理する際に、ガラス中の Ca O成分と、 バッファードフッ酸による反応生成物が、ガラス表面に多量に析出してガラス基 板を白濁させやすくなる。それとともに、反応生成物によってガラス基板上に形 成される素子や薬液が汚染されやすくなる。

BaOは、ガラスの耐薬品性、耐失透性を向上させる成分である。 <math>BaOの含有量は、 $0.1\sim5.0%$ 、好ましくは、 $0.1\sim4.5%$ である。0.1%より少ないと、上記効果が得られず、5.0%より多いと、ガラスの密度が上昇するため好ましくない。

SrOは、BaOと同様にガラスの耐薬品性を向上させると共に、失透性を改善させる成分である。しかも、SrOはBaOに比べて、溶融性を悪化させにくいという特徴を有している。しかし、SrOを多量に含有すると、ガラスの密度が高くなるため好ましくない。従って、SrOの含有量は、 $O.1\sim10.0\%$ 、好ましくは $1.0\sim9.0\%$ である。

ZnOは、耐バッファードフッ酸性を改善すると共に、溶融性を改善する成分である。 <math>ZnOの含有量は、 $0\sim5$. 0%である。 5. 0%より多いと、逆にガラスが失透しやすくなると共に、歪点が低下するため、優れた耐熱性が得られない。

ただしMgO, CaO, SrO, BaO及びZnOの合量が5. 0%より少ないと、高温での粘性が高くなり、溶融性が悪くなると共に、ガラスが失透しやすくなる。一方、MgO, CaO, SrO, BaO及びZnOの合量が20. 0%より多いと、ガラスの密度が高くなるため好ましくない。

ZrO $_2$ は、ガラスの耐薬品性、特に耐酸性を改善すると共に、高温粘性を下げて溶融性を向上させる成分である。ZrO $_2$ の含有量は、 $0\sim5$. 0%, 好ましくは 0. $1\sim4$. 0%である。5. 0%より多いと、失透温度が上昇し、ジルコンの失透異物が折出しやすくなる。

 TiO_2 も、耐薬品性、特に耐酸性を改善すると共に、高温粘性を低下し、溶 融性を向上させ、さらに紫外線による着色を防止する成分である。即ち、液晶ディスプレイ等を製造する場合、ガラス基板上の有機物を除去するために紫外線を

ではかけましてない。そのためこの類のようスとも信仰によってもは記りません。そのなりこともはは、まりはない。そのためこの類のようとはには、株外線によって着色しないことが要求される。しかしながら、 TiO が5. 0%より多いと、近にがけられる。

される各種の膜や半導体素子の特性を劣化させるため好ましくない。また, 一般に融剤として使用されるPb0は, ガラスの耐薬品性を著しく低下させる。それによって、Fb0は溶融時に融液の表面から揮発し, 環境を汚染するせる。それによった。

3かみはよせると共に 配換に配到として使用される。しかし、P2Obは、ボラックはかかみさいでであった。 5 しまに配到として使用される。しかし、P2Obは、ボックはからなけるでは、ボックはないのでは、アンクロン・ボールをはいった。

さらに、 P_2 O_5 も一般に融剤として使用される。しかし、 P_2 O_5 は、 $分 O_5$ は、 $<math>O_5$ は、 O_5 は、O

あるしては使用できなくなる。 あるも間に記づいて更に、詳細に説明する。 、これとは、計算の無アルカリガラス基板を例に基づいて更に、詳細に説明する。 、記)ストはの例類出ら(1~10)とは例のがラストの には、またの例類出ら、1~10)とは説明である。 には、1~10)とはの例類には、1~10)とは説明である。 には、1~10)とはの例類には、1~10)とは説明では、1)と、1)を には、1~10)とはの例類には、1~10)とは説明では、1)と、1)を には、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)と には、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)と には、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)とは、1~10)と には、1~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10)とは、10~10~10)とは、10~10~10)とは、10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~1

はいる。 11~14)を示すものである。 表中の各試料は、次のようにして作製した。まず表の組成となるようにガラス 表中の各試料は、次のようにして作製した。まず表の組成となるようにガラス

たれうス原料をカーボン板上に流し出し、板状に成形した。 されでいったとの形をあれる。 されでいったとうに、な変明例であるN0. $1 \sim 100$ 0名試料は、いずれも 密度かN2. $1 \sim 100$ 0名式料は、N2. $1 \sim 100$ 0名式料は、N3. $1 \sim 100$ 0名式料は、N3. $1 \sim 100$ 0名式料は、N3. $1 \sim 100$ 0名式料は、 $1 \sim 100$ 0

れも良好な特性を有していた。

(重量%)

								
試料No.		本	発		明	例		
組成	1	2	3	4	5	6	7	8
SiO ₂	60.0	61. 0	59. 9	62. 5	64. 0	61.5	610	63. 0
Al ₂ O ₃	17. 0	18. 0	16. 5	20. 5	21. 0	19.0	13. 5	17. 0
B ₂ O ₃	9. 0	11. 0	9. 0	6. 0	6. 5	7. 5	8.5	10.0
MgO	_	0. 5	_	1. 5	0.5	1. 0	-	_
CaO	5. 5	3. 5	2. 1	6.0	7.0	3. 0	2. 5	7. 5
ВаО	4. 0	1. 0	3. 5	1.5	0.5	0. 5	2. 0	0. 5
SrO	3. 5	2. 0	6. 5	1.5	0. 5	5. 0	9. 0	1. 0
ZnO	0.5	1. 0	0. 5		-	1.0	_	1. 0
ZrO ₂	0.5	2. 0	1. 0	– .	_	_	1.5	
TiO ₂	1	_	1. 0	0.5	-	1.5	2. 0	-
密度 (g/cm ³)	2. 50	2. 40	2. 51	2. 45	2. 39	2. 46	2. 51	2. 39
歪点 (℃)	681	689	676	691	719	671	668	670
耐塩酸性	0-	0	- 0-	0	0	0	., 0	0
耐バッファードフッ酸性	0	0	0	0	0	0	0	0
耐失透性	0	0	.0	0	0	0	0	0.
10 ^{2.5} ポイズ温度 (℃)	1592	1611	1604	1621	1623	1625	1605	1594

(%喜專)

102.5 ポイズ温度(で) 1625 8691 Ö 0 **盐**蚕头锸 0 0 **封廻 ペ に オート に や が 傾** 0 0 到這麼年 (プ) 点歪 899 TOL 2, 45 歪底 (g∕cm³) S 39 T 0 TiO2 ζΟ <u>1</u> Ζ **G.** .0 0.5 I' 0 ΟuΖ 9.0 J. 0 . O 1 S 0.5 0.5 ВзО 3.0 8 .8 OaO 0: 2 MRO $B^{5} O^{3}$ 9.0 3,8 EO SIA 0 [61 18.5 Sio 9T' 2 63. 5 J 0 6 须왦 限即発本 .0 N 基础

表 2 第

第 3 表

(重量%)

試料No.	Ŀ	t ŧ	Ż ₹	aj ·
組成	11	.1 2	1 3	14
SiO ₂	61. 0	62. 5	61.0	69. 0
A1 ₂ O ₃	13. 0	18. 5	15. 0	11. 5
в ₂ о ₃	9. 5	6. 5	5.0	5. 5
MgO	5. 0	2. 0	2. 5	1. 0
CaO	4.5	6. 5	3. 0	4. 0
ВаО	4. 0	-	7.0	4. 0
SrO	2. 0	4. 0	5. 0	3. 0
ZnO	1. 0	- -	1. 5	2. 0
ZrO ₂	_	-	-,	-
TiO2		-	. –	_
密度 (g/cm³)	2. 54	2. 47	2. 63	2. 50
歪点 (℃)	650	682	697	660
耐塩酸性	0_	Δ	_O-	
耐バッフアードフッ酸性	0	×	0	0
耐失透性	×	,×	0	×
10 ^{2.5} ポイズ温度 (℃)	1570	1507	1620	1705

、11体はの61、01、よいてに尖い世を失価と曲品薬師、11体はの21、01 、けた。よいてに投い出数共価、計学語の11.0NAもで同様出し校ゴバチ

。六~仏悪が掛媼容 、〉 高が 夏監 ストホ

」」>○多のように体むの小変〉全、△多のようれる見が高白づべでは、×多のよ よっ人が々ゃそ々、ひよし濁白が面表の改基スでは、ひるでのよけし研究したよ コムこるも楽贈る凱状面表の改善スでは、多けし賢長間代06コ新育館ペワイー ってゃいるおらん顔ゃて%量重3.1.4ムウニチンで小ゃて%量重7.8mれた 当時出り。00°00に各部には、光学研磨した各部料を、20°0に保持さ 将ファよコムこるも寒騒を恵状面表の改善スでは、炎はし散受間部42コ南谷木 耐塩酸性は,各試料を光学研磨してから,80℃に保持された10重量%塩酸 。式し宝脈アバで基コ武式のIT-8880

題表表の多式し野処熱間割001で20021、ホ人コ内1-1を白きれこ、し | 墺引き末伐スミはるも育き至跡のm 4 0 0 G ~ 0 0 E d 4 体揺各 、利型委共師 ٥Ţ

を示る裏盤るもど目コズトキ ^{6.2}0 1 るるう 割お監高 、お 裏 監 ストキ ^{6.2}0 I よなかったものを○とした。 る6點>全,×季のよされる6點もでしむ4秒表史, eもでのよう6米ファよコ深

るるで不以 6mっ入888、2次割密をかし、水多ご当然放蝗容、出品薬師、当 禁師、もす育合多成小難園金したれてコ的賀実、おけよコ肥発本コらよの土以 るのであり,この温度が低いほど,容融成形性に優れていることになる。

。るきがはくこるも典匙を疎基スではじたNて無

世錦に用味の土業国

。5.65で函刊フリム郊基スでみるれる用動コトレヤスト ることができ, 侍に軽量化が要求されるTFT型アクティブマトリックス施品デ FLディスプレイ等のディスプレイ, フィルター, センサー等の甚板として用い ,トリアストテ昌郊 ,打団基スでけした小て無の即発本 ,コごよけし即端 ,土以

請求の範囲

1. 重量百分率で、 SiO_2 58. 0~68. 0%、 Al_2O_3 10. 0~25. 0%、 B_2O_3 3. 0~15. 0%、MgO 0~2. 9%、CaO 0~8. 0%、BaO 0. 1~5. 0%、SrO 0. 1~10. 0%、ZnO 0~5. 0%、 ZrO_2 0~5. 0%、 TiO_2 0~5. 0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/02751

ł	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int	. Cl ⁶ C03C3/091, C03C3/09:	3				
According	to International Patent Classification (IPC) or to bo	th national classification and IPC				
B. FIE	LDS SEARCHED					
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
Int	. Cl ⁶ C03C3/091, C03C3/093	3				
Kok: Tore	tion scarched other than minimum documentation to the suyo Shinan Koho ai Jitsuyo Shinan Koho oku Jitsuyo Shinan Koho	1926 - 1996 1971 - 1996 1994 - 1996				
Electronic d	ats base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, search	terms used)			
÷			· ·			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Calegory*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X	JP, 4-325436, A (Nippon Sh	eet Glass Co., Ltd.),	1			
. *	November 13, 1992 (13. 11. Column 1, lines 2 to 9 (Fa	92), mily: none)				
A	JP, 4-175242, A (Asahi Gla	ss Co., Ltd.),	1			
٠. ٠	June 23, 1992 (23. 06. 92) Page 1, left column, line	, to right column				
	line 8 (Family: none)	J to right condimit,	•			
A	JP, 61-281041, A (Asahi Glass Co., Ltd.), December 11, 1986 (11. 12. 86), Page 1, left column, line 5 to right column,					
	line 16 (Family: none)	,				
			•			
,						
.		.				
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume	Special categories of cited documents: "I later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand					
	particular relevance ocument but published on or after the international filing dat	the principle or theory underlying the "X"—document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
. cited to	at which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or othe reson (as specified)	s step when the document is taken alone	ered to involve an inventive			
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination						
	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "A" document member of the same patent family					
Date of the a	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
Dece	mber 16, 1996 (16. 12. 96)	December 25, 1996	(25. 12. 96)			
Name and m	ailing address of the ISA	Authorized officer				
Japa	nese Patent Office					
Facsimile No	<u> </u>	Telephone No.				

		国際田駅番号 アレーノーア	36/0275	
A. 癸明 a. Int Cl ·	D属する分野の分類(国際特許分類(IPC) C03C3/091、 C03C3/09;)		
B. 調査を	行った分野	· .		
調査を行った Int Cl・	最小限資料(国際特許分類 (IPC)) C03C3/091、 C03C3/093	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		•		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実	用新案公報 1926-1996年 開実用新案公報 1971-1996年	•	•	
日本国登	録実用新案公報 1994-1996年			
国際調査で使	用した電子データベース(データベースの名称			
		,	•	
C. 関連す	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	るときは、その関連する意味の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	JP.4-325436.A (日本板硝子株式会社) 13.1 (ファミリーなし)	1月. 1992(13. 11. 92), 第 1 欄, 第 2 - 9 行	明水の製匠の番号	
Α .	JP. 4-175242. A (旭硝子株式会社) 23. 6月. 1	992(23 06 92) 第1頁 左脚 等5径 周		
·	頁,右欄,第8行(ファミリーなし)			
Α	JP, 61-281041, A(旭硝子株式会社)11.12月. 同頁.右楣.第16行(ファミリーなし)	1986(11.12.86),第1頁,左欄,第5行一	1	
		. ,		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献の 「A 」特に関連)カテゴリー のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献		
もの		て出願と矛盾するものではなく、	れた文献であって 発明の原理又は理	
の·	ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	論の理解のために引用するもの 「X」特に関連の本名文献でも、アール		
し」優先権主 日若しく	張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、当	られるもの	
文献(理	由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって白	明である組合せに「	
「P」国際出頭	日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	€ ∅	
国際調査を完了	した日 16.12.96	国際調査報告の発送日 25.1	2.96	
日本国	名称及びあて先 特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 三崎 仁 ロ	4 G 8 9 2 8	
郵(東京都	更番号100 千代田区蔵が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3 4 1 6	
		,		